

06.2;06.3

СЕЛЕКТИВНЫЙ ФОТОДИОД С ДВУКООРДИНАТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

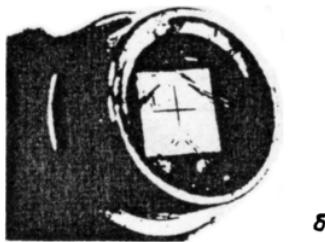
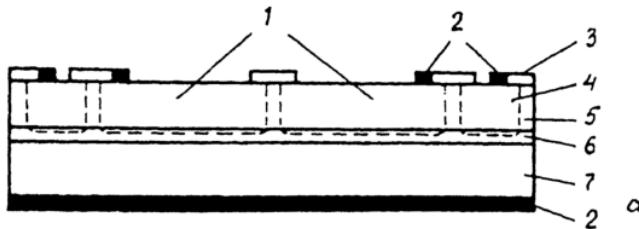
© В.В.Дороган, В.И.Брынзарь, Г.С.Коротченков,
Т.С.Виеру, В.А.Косяк

Предложены новая конструкция фотодиода с двукоординатной чувствительностью на основе гетероструктур InP-InGaAsP, технология его изготовления, основные характеристики и параметры. В отличие от аналогов на основе Si фотодиод обладает селективной спектральной фоточувствительностью с полушириной спектра $\Delta\lambda = 75$ нм и повышенной чувствительностью для $\lambda = 1.06$ мкм ($S_{\lambda=1.06} = 0.57$ А/Вт). Это дает возможность использовать его без дополнительных интерференционных фильтров в оптоэлектронных системах для управления быстродвижущимися в пространстве объектами.

Одно из основных применений фотодиодов с двукоординатной чувствительностью (квадрантов) — использование их в системах ориентирования и управления объектами, движущимися в пространстве с большой скоростью. Для этого используется лазерное излучение с длиной волны $\lambda = 1.06$ мкм, у которого минимальный коэффициент поглощения в атмосфере. Важно также, чтобы квадранты имели высокую эффективность преобразования излучения с длиной волны $\lambda = 1.06$ мкм, были помехоустойчивы и инертны к оптическому фону, т.е. ко всему спектру излучения, кроме $\lambda = 1.06$ мкм [1].

В данной работе представлены конструкция, технология изготовления, параметры и характеристики квадранта, изготовленного на основе гетероструктур InP-Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}, с селективной фоточувствительностью и повышенной эффективностью для $\lambda = 1.06$ мкм.

Структура квадранта, выращенная методом жидкофазной эпитаксии, представлена на рис. 1. Первый слой двойной гетероструктуры (6) составом "x" и "y" имеет ширину запрещенной зоны $E_{g1} = 1.12$ эВ, концентрацию свободных носителей $n_1^0 \sim 10^{16}$ см⁻³ и толщину $d_1 = 3$ мкм. Он является активным слоем, т.е. в нем происходит поглощение излучения с $\lambda = 1.06$ мкм и разделение фотогенерированных носителей. Фронтальный слой гетероструктуры (5) с $E_{g2} = 1.18$ эВ, $n_2^+ \sim 10^{17}$ см⁻³ и $d_2 = 7$ мкм выполняет роль оптического фильтра, т.е. излучение с $\lambda < 1.05$ мкм поглощается в этом слое, а фотогенерированные носители,



б

Рис. 1. Структура квадранта (а) и прибор в корпусе (б): 1 — фотоактивные элементы; 2 — металлические контакты; 3 — маска из SiO_2 ; 4 —периферийное кольцо; 5 — эпитаксиальный слой InGaAsP с $E_g = 1.18$ эВ; 6 — эпитаксиальный слой InGaAsP с $E_g = 1.12$ эВ; 7 — подложка InP .

из-за большой толщины слоя, не доходят до $p-n$ перехода и не дают вклад в фотоответ. $P-n$ переход создан методом диффузии Zn из квазизамкнутого объема и находится в слое с $E_{g1} = 1.12$ эВ или в слое с $E_{g2} = 1.18$ эВ, но в непосредственной близости от гетерограницы, тем самым обеспечивается эффективное разделение носителей, генерированных излучением с $\lambda = 1.06$ мкм. Квадрант имеет круглую форму (рис. 1, б) и состоит из пяти фоточувствительных элементов: четыре элемента сектора (1) для определения позиции светового сигнала (пятна) и пятый элемент — периферийное кольцо (4) для ограничения рабочего поля квадранта. Формирование этих пяти элементов происходит в процессе диффузии Zn с использованием маски из SiO_2 (3). Металлические контакты (2) изготовлены методом вакуумного напыления металлов ($\text{Au} + \text{Ni}$; Al). В качестве просветляющих покрытий использовались слои Al_2O_3 или ZnS .

Анализ вольт-амперных характеристик показал, что темновые токи каждого сектора квадранта определяются поверхностными и объемными утечками и зависят от совершенства гетероструктуры, от положения $p-n$ перехода от-

Таблица

1	Общая поверхность квадранта, см ²	$4.9 \cdot 10^{-2}$
2	Фоточувствительная поверхность одного сектора, см ²	$6.7 \cdot 10^{-3}$
3	Длина волны в максимуме спектра фоточувствительности, мкм	1.07
4	Полуширина спектра фоточувствительности, нм	75–85
5	Абсолютная чувствительность (для $\lambda = 1.06$ мкм), А/Вт	0.51–0.57
6	Квантовая эффективность, %	60–65
7	Напряжение холостого хода, В	0.53–0.57
8	Собственная емкость одного сектора ($U = 0$), пФ	< 400
9	Предельная частота, кГц a) $R_h = 8$ кОм ($\tau = R \cdot C = 4.5 \cdot 10^{-6}$ с) б) $R_h = 50$ Ом ($\tau = 2 \cdot 10^{-8}$ с)	36 8000
10	Обнаружительная способность ($\Delta f = 0.3$ – 10 кГц), см · Гц ^{1/2} · Вт ⁻¹	$\sim 10^{12}$
11	Темновые токи ($U_{обр} = 0.5$ В), мкА	0.002–4
12	Крутизна координатной характеристики, В · Вт ⁻¹ · мм ⁻¹	$(5\text{--}7) \cdot 10^3$

носительно гетерограницы между слоями, а также от толщины металлических контактов и от технологии присоединения выводов к омическим контактам кристалла (термокомпрессия или ультразвуковая пайка). Маленькая толщина металлических контактов (< 0.5 мкм) приводит к возникновению дополнительных дефектов при соединении выводов методом термокомпрессии, следовательно к резкому росту темнового тока.

Величины темновых токов, а также другие основные параметры для серии диодов представлены в таблице. Концентрация ионизированных примесей в области объемного заряда p – n перехода, рассчитанная из вольт-фарадной характеристики, составляет $N_d = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻³ и может быть снижена до $5 \cdot 10^{14}$ см⁻³ путем легирования жидкой фазы редкоземельными элементами, в частности иттрием, а также применяя длительные отжиги жидкой фазы при высоких температурах ($T \approx 900$ °C).

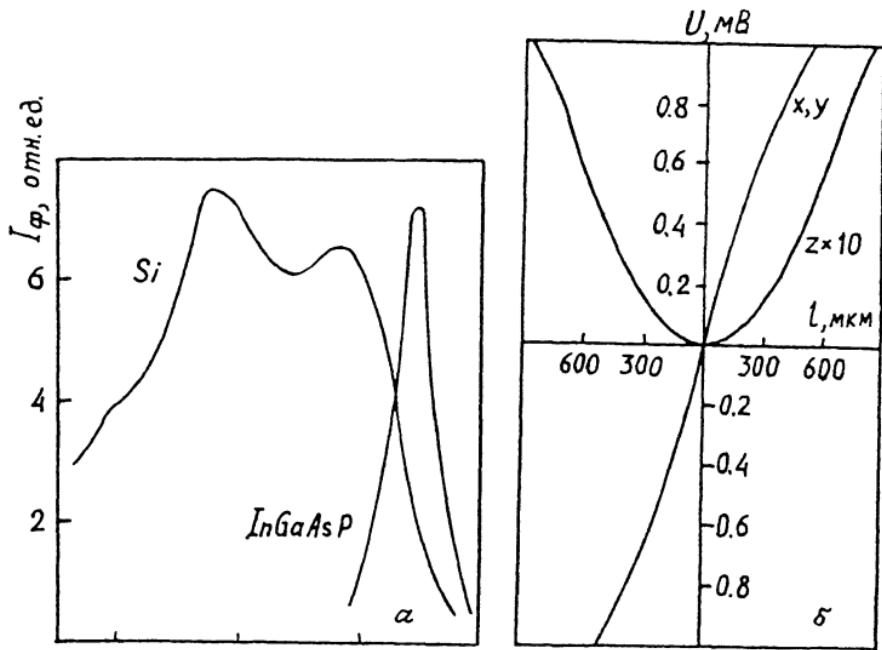


Рис. 2. Спектры фоточувствительности (а) и координатные характеристики (б).

На рис. 2, а представлены спектры фоточувствительности квадрантов на основе структур InP-InGaAsP и Si. Видно, что для длины волны $\lambda = 1.06$ мкм фоточувствительность квадранта на основе InGaAsP в два раза больше, чем фоточувствительность Si квадранта, и составляет $S_{\lambda=1.06} = 0.57 - 0.6$ А/Вт. Другое преимущество квадранта на основе InGaAsP — это узкая полоса фоточувствительности с максимумом при $\lambda = 1.06$ мкм, т. е. его селективность.

Полуширина спектра фоточувствительности составляет $\Delta\lambda = 75 - 85$ нм. Это позволяет использовать квадрант в системах приема оптической информации без дополнительных интерференционных фильтров. Следует сказать, что значение полуширины спектра фоточувствительности может быть уменьшено. Для этого необходимо уменьшить разность между ширинами запрещенных зон эпитаксиальных слоев $\Delta E_g = E_{g2} - E_{g1}$. Но в этом случае уменьшается и абсолютное значение спектральной фоточувствительности квадранта. Большое значение имеет толщина фронтального слоя. В случае, когда $\alpha d_2 < 1$, коротковолновый край спектра фоточувствительности смещается в сторону меньших длин волн и квадрант теряет свою селективность.

На рис. 2, б представлены координатные характеристики квадранта. Диаметр светового пятна равен радиусу сектора $r = 1.1$ мм. Интегральная мощность светового сигнала в

пяtnе составляет $8 \cdot 10^{-7}$ Вт. Крутизна координатной характеристики рассчитывается по формуле $K = \Delta U(\Delta x \cdot \Delta P)^{-1}$ и равна $K \approx 10^4$ В/(Вт · мм) при равенстве сопротивления нагрузки R_s и темнового сопротивления элементов (секторов) квадранта R_t ($R_s = R_t = 50$ кОм).

Таким образом, в результате проведенных исследований создана новая конструкция квадранта на основе гетероструктур InP-InGaAsP с селективной фоточувствительностью и с повышенной спектральной чувствительностью для $\lambda = 1.06$ мкм.

Список литературы

- [1] Dorogan V.V., Brynzari V.I., Korotchenkov G.S. et al. // 20th International Conference on Microelectronics (MIEL'95), Nis, Serbia, 12-14 September 1995. V. 1. P. 431-434.

Поступило в Редакцию
2 июля 1996 г.
